

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2022年11月3日(03.11.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/230613 A1

(51) 国際特許分類:  
B05C 5/00 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)  
H01L 21/027 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/016775

(22) 国際出願日: 2022年3月31日(31.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願 2021-076528 2021年4月28日(28.04.2021) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP). 株式会社アイセロ(AICELLO CORPORATION)

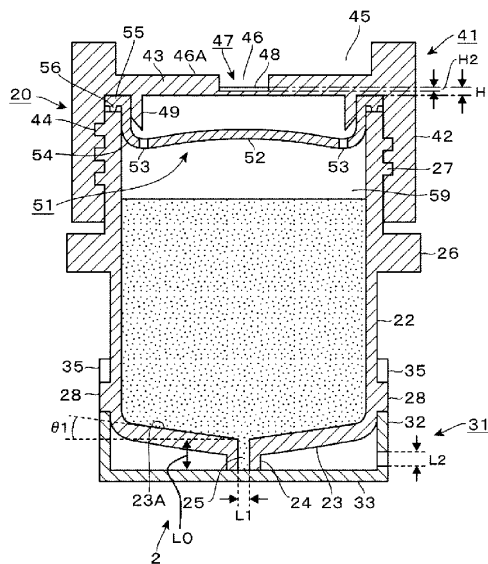
[JP/JP]; 〒4411115 愛知県豊橋市石巻本町字越川4 5番地 Aichi (JP).

(72) 発明者: 土屋 勝裕 (TSUCHIYA Katsuhiko); 〒1076325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 平尾 剛 (HIRAO Takeshi); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP). 稲田 博一 (INADA Hiroichi); 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP). 沓名 芳道 (KUTSUNA Yoshimichi); 〒4411115 愛知県豊橋市石巻本町字越川4 5番地株式会社アイセロ内 Aichi (JP). 山本 高司 (YAMAMOTO Takashi); 〒4411115

(54) Title: CONTAINER

(54) 発明の名称: 容器

[図5]



(57) Abstract: The present invention provides a technology which makes it possible to reduce the time of processing and the time of works associated with the processing when a substrate is processed with use of a processing liquid. According to the present invention, a container is configured so as to comprise: a retention space formation part (20) which is internally provided with a retention space (59) for retaining a processing liquid that is used for the purpose of processing a substrate; an ejection port (25) for the processing liquid, the ejection port being provided on the retention space formation part; and

[続葉有]

WO 2022/230613 A1

愛知県豊橋市石巻本町字越川 4 5 番地 株式会社アイセロ内 Aichi (JP).

(74) 代理人:特許業務法人弥生特許事務所(YAYOY PATENT OFFICE); 〒2310058 神奈川県横浜市 中区弥生町 2 丁目 1 5 番 1 号ストークタワー 大通り公園 3 6 0 1 号 Kanagawa (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

a fragile part (47) that is provided on the retention space formation part so as to be ruptured when pressed by an entry part, which pressurizes the retention space so that the processing liquid is ejected from the ejection port, in order to form an approach path through which the entry part enters into the retention space formation part.

(57) 要約: 処理液を用いて基板を処理するにあたり、処理の手間及び処理に付随する作業の手間を軽減することができる技術を提供する。基板を処理するための処理液を貯留する貯留空間(59)が内部に形成された貯留空間形成部(20)と、前記貯留空間形成部に設けられる前記処理液の吐出口(25)と、前記吐出口から前記処理液が吐出されるように前記貯留空間を加圧する進入部を前記貯留空間形成部の内部に進入させる進入路を形成するために、当該進入部の押圧で裂けるように当該貯留空間形成部に設けられる脆弱部(47)と、を備えるように容器を構成する。